

半導体を中心とする電子デバイスのプロセス技術において、材料表面を清浄化・改質する技術はデバイス界面の信頼性に対して極めて重要である。また、ウェットプロセスを用いた新規なエッチングや薄膜を形成する技術は、デバイスの微細化・三次元化のひとつのテクノロジードライバである。本研究会は界面ナノ現象を明らかにすることでウェットプロセスに関する学問を構築し、次世代へと教育できる環境を整えている。同時に本研究会成果物の実行者である若手の主体性が極めて重要であることから、若手の主体性強化を目的としたポスター発表展を2015年より企画している。若手技術者とベテラン技術者とのFace to faceの活発な議論を期待して、下記の要項で第6回ポスター展を開催する。

## 若手のポスター発表展 －ベテランとの議論に打ち勝て！－

■ 主催：公益社団法人 応用物理学会 界面ナノ電子化学研究会

■ 日時：2021年10月14日（木） 13：00～17：00

■ 会場：オンライン（Zoom）  
※Zoomのブレイクアウトルーム機能を使用します。  
※事前登録後、Zoomアドレスを案内します。

■ ポスター掲載期間：2021年10月7日（木）～10月30日（木）  
※LINKBizを使用したオンライン掲載を行います。  
※事前登録後、掲載アドレスを案内します。

■ 参加費：無料

<https://forms.gle/dZ4F4GJcPz9Mqx529>

■ 申込方法：  
参加申込先URLもしくはQRコードより、アンケートにご回答頂く形でお申し込みをお願い致します。  
申し込み用Googleフォームにアクセスできない際は、下記世話役へご連絡をお願い致します。

■ 申込締切：2021年9月30日（木）

■ ポスター発表展終了後、18:00よりオンラインにて第30回カサロスWeb(懇親会)を開催します。

■ 世話役：  
オルガノ 蔦野恭平 tsutano-k@organo.co.jp  
日本インテグリス 永淵琢也 takuya.nagafuchi@entegris.com

参加申込先



タイトル	発表者	所属
1 ナノ構造物に対する昇華乾燥手法の適用と倒壊原因パラメータの考察	國枝 省吾	株式会社SCREENホールディングス
2 静止および動作中のPVAブラシと接触面の相互作用～表面近傍のブラシ存在割合とノジュール体積変化測定～	保坂 篤紀	静岡大学
3 Wet Atomic Layer Etching of Cobalt	坂崎 哲也	東京エレクトロン九州株式会社
4 The Effects of Reductant on the Cleaning Performance for Ceria slurries with Post CMP cleaning	高中 亞鈴治	関東化学株式会社
5 Optimized combination of ion exchange resins for the removal of trace amount of metal impurities from isopropyl alcohol	森野 翔太	オルガノ株式会社
6 アモルファスシリコンにおけるアルカリエッチングの反応メカニズム考察	黒木 佳奈	ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社
7 新規洗浄水を用いた半導体材料の溶解コントロール技術	顔 暢子	栗田工業株式会社
8 音叉型水晶振動子を力センサーに用いたFM-AFMによる高湿度環境でのKBr表面の観察	桐山 和大	金沢大学
9 周波数変調原子間力顕微鏡を用いたナノ水膜吸着表面の原子分解能観察	浜本 和	金沢大学
10 エバネッセント光を応用した超音波洗浄時におけるサブ30 nm金単粒子剥離・再付着挙動の実時間可視化	寺山 裕	九州工業大学
11 二流体スプレー洗浄時における静電気特性の把握	鈴木 洋陽	愛知工業大学
12 振動体型超音波洗浄におけるポリスチレンラテックス粒子の除去率の周波数依存性	高木 羅以	愛知工業大学
13 AI技術を用いた高圧純水スプレー時の発生静電気の予知技術の確立	福岡 靖晃	愛知工業大学